

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【公開番号】特開2007-234964(P2007-234964A)

【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【年通号数】公開・登録公報2007-035

【出願番号】特願2006-56412(P2006-56412)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

H 01 L 21/308 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 5 Z

H 01 L 21/304 6 4 7 Z

H 01 L 21/308 E

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月17日(2009.2.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

オゾンにより表面に酸化膜が形成されたシリコンウエハを、アンモニア、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリンのうちいずれか一種以上の薬品と過酸化水素との混合液で洗浄することを特徴とする、シリコンウエハの洗浄方法。

【請求項2】

前記酸化膜の初期厚さ未満の厚みの酸化膜をアンモニア、水酸化テトラメチルアンモニウム、コリンのうちいずれか一種以上の薬品と過酸化水素との混合液で洗浄してエッティングすることを特徴とする、シリコンウエハの洗浄方法。